

◎特許法等の一部を改正する法律

(令和元年五月一七日法律第三号)

一、提案理由 (平成三十一年四月一〇日・衆議院経済産業委員会)

○世耕国務大臣 特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

第四次産業革命により既存の業種の垣根を越えたオープンイノベーションが進む中、中小・ベンチャー企業がすぐれた技術を生かして飛躍するチャンスが拡大しております。また、商品、サービスそのもののみならず、すぐれたデザインを提供し、ユーザーの満足度を高めることが、競争力を左右する重要な要素になってきております。

こうした状況を踏まえ、苦勞して取得した権利で大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善するとともに、デジタル技術を活用したデザインの保護やブランド構築等のため、意匠制度等を強化する必要があることから、本法律案を提出した次第であります。

次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

まず、産業財産権に関する訴訟制度の見直しです。

第一に、特許権の侵害の可能性が高い場合には、裁判所が選定する中立な技術専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設します。

第二に、侵害者が得た利益のうち、権利者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できるようにする等、損害賠償額の算定方法を見直します。

次に、意匠制度の改善です。

第一に、物品に記録、表示されていない画像デザインや、建築物の外観、内装のデザインを、新たに意匠法の保護対象とします。

第二に、自己の登録意匠等に類似する意匠の登録を認める関連意匠制度を拡充し、一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインの保護を可能とします。

第三に、意匠権の存続期間を、登録日から二十年から、出願日から二十五年に変更します。

第四に、模倣品の取締りを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造、輸入する等の行為を意匠権侵害とみなし、取り締まれるようにします。

次に、商標制度の改善です。

国、地方公共団体、非営利の公益団体等がみずからを表示する著名な商標権について、他人に通常使用権を許諾することを可能とします。

以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

二、衆議院経済産業委員長報告 (平成三十一年四月一六日)

○赤羽一嘉君 ただいま議題となりました特許法等の一部を改正する法律案につき、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

本法律案は、産業財産権に関する訴訟制度の改善を図るため、中立な技術専門家が特許権の侵害立証に必要な現地調査を行う制度を創設するとともに、損害賠償額の算定方法を見直すほか、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、意匠制度について、保護対象の拡充等を図るものであります。

本案は、去る四月九日本委員会に付託され、翌十日世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。十二日、質疑を行い、質疑終局後、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

なお、本案に対し、厳しい国際競争環境のもと、諸外国の動向を注視しつつ、制度の不断の見直しを行う等、三項目にわたる附帯決議が付されました。

以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成三一年四月一二日）

高齢化社会・人口減少社会などの社会問題に対処し、経済産業の活性化を図るため、イノベーションの促進・強化と日本社会への実装化が極めて重要である。この問題意識に基づき、政府は本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 特許法等の知的財産制度を有効に機能させ、かつ、その社会的役割が十分に発揮されるよう、制度の不断の見直しを行うとともに、制度運用の実効性を注視していくこと。

二 いわゆる「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討すること。

三 厳しい国際競争環境の下、懲罰的賠償制度の導入や証拠収集制度の見直し等、諸外国における知的財産制度改革が急激に進展する状況において、諸外国で活動する日本国民が不利になることのないよう注視し、状況の変化に応じてスピード感のある制度改革が実現できるよう、諸外国における関連情報の収集・分析を強化すること。

三、参議院経済産業委員長報告（令和元年五月一〇日）

○浜野喜史君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。

本法律案は、知的財産を適切に保護し、その活用を図るため、特許権侵害訴訟について、裁判所が指定する査証人が、侵害立証に必要な証拠の収集を行うための査証を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設するとともに、損害賠償額の算定方法の見直しを行うほか、画像及び建築物を意匠権の保護対象に追加する等の意匠制度の拡充に係る措置等を講じようとするものであります。

委員会におきましては、査証制度創設の効果とその運用の在り方、諸外国の動向を踏まえた損害賠償制度の見直しの必要性、意匠制度拡充の意義と今後の対応、中小・ベンチャー企業に対する知財活用に向けた支援の必要性等について質疑が行われましたが、

その詳細は会議録によって御承知願います。

質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。

以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（令和元年五月九日）

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

- 一 我が国産業の国際競争力強化やイノベーション創出等の重要性に鑑み、特許法等の知的財産制度が有効に機能し、その役割が十分に果たされるよう、諸外国における制度改革の進展に適切に対応しつつ、制度の不断の見直しを行うとともに、制度運用の実効性を注視していくこと。
- 二 新たに創設される査証制度については、営業秘密等の保護に留意しつつ、必要な査証が適切に実施され、実効的な権利保護が図られるよう、その運用について適宜検証し、必要な見直しの検討を行うこと。
- 三 いわゆる「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討すること。
- 四 意匠権の保護対象の拡充に当たっては、クリアランス負担の軽減や十分な審査体制の確保に努めること。

右決議する。